



若 者

国際学会に参加して

魏

津*

国際学会というと海外と英語を連想する人は多いでしょう。海外の国際学会で英語で発表したと聞くだけで思わず“すごい”と言ってしまいう時代が過ぎ、それは日常茶飯事になりつつあります。国際学会で日本人が講演している風景がしばしば見られます。私の研究分野で、日本は世界のトップを走っており、日本人研究者は少なくありません。日本国内でも国際学会は数多く行われています。

私はいま大阪大学電気工学科平木研究室で、ダイヤモンド薄膜の研究をしています。大学院生をどんどん国際学会に出すという研究室の方針で、私は平木研に来てから2年間に運良く“海外”での国際学会に2回も出して頂いて発表して来ました。海外というと私にとって、日本も海外ですが、日本を自分の第二の故郷だと思っている私には本当の海外は日本以外の外国になります。

はじめて海外へ行く、その上国際学会で母国語以外の言葉で発表するのは誰もが緊張します。1回目の海外での国際学会でいろいろな思い出を残される方も少なくないでしょう。その中には、苦い体験もあれば、ロマンチックなエピソードもあるでしょう。学会後から研究姿勢が変わり、より一層努力して研究を進める方も数多くいらっしゃいます。国際学会によって若い研究者が成長していくと言えるでしょう。

私が参加した国際学会は2回ともアメリカで開催されたものでした。1回目はすべてが勉強になりましたが、アメリカについての事前勉強不足で苦い体験もしました。それに比べて2回目は比較的苦労せずに“堂々”と行って来まし

た。ここで、私の国際学会に行った時の体験と感想を紹介します。

1回目は昨年5月にロサンゼルスで行われた Frist International Symposium on Diamond and Diamond-Like Films, 175th Meeting of the Electrochemical Societyでした。出発するまで連日の論文まとめとOHP作りに追われ、アメリカの風習、現地に着いてからホテルまでの行き方と電話のかけ方さえ分らないまま航空券、パスポートと一冊のアメリカ西海岸のガイドブックだけを手にして大阪から出発しました。そのガイドブックも空港で購入したものでした。

ロサンゼルス国際空港に着いて、中国—日本を何回も往復した経験を生かして簡単に入国の手続を済ませ、荷物を持ってアメリカに入国しました。税関から出てくると成田、大阪空港のにぎやかさはなく、到着ロビーにも人が少なくインフォメーションのところにしてもおじいさん1人しかいなかったのです。何という“ひろい”空港だと思いました。(ロスの空港はアメリカにも少ない特徴のある空港というのが後で分かりました。)出発するまでの疲れと10時間ぐらいの飛行機生活ですぐにもホテルにチェックインしたかったのです。まずロス在住の友人に電話をするのにもコインも持っていなかったのです。両替しようとして苦労してやっと目立たないところで両替機を見つけて両替しました。おまけに両替機をさがしてロビーで何往復もしているところを警備員に呼び止められ、パスポートと荷物についている名札まで検査されました。電話機に書いてある説明文を読みながら友人に電話をかけたが、結局、友人は留守で連絡がとれなかったのですが、両替したばかりの“大事な”コインは一つも返って来ませんでした。(ア

*魏 津 (Jin WEI), 大阪大学大学院工学研究科平木研究室, 博士課程3年生, 電気工学専攻

メカリの公衆電話はおつりはでません。オペレータの指示に従って必要なだけの小銭を追加するシステムになっています。)そして、一人でホテルまで行くことに決め、インフォメーションのおじいさんにホテルの名前を告げ、行き方を尋ねました。“そのホテルだったら絶対に送迎バスがある。前の道沿いで待っていたらバスが来るので、それにのったらず間違いなし”と教えてくれました。その言葉を信じて1時間も待って結局来なかったのです。待っているうちに空港から出てくる人々は、次々と来るマイクロバスの運転手と何かを話してバスに乗り込んで空港を離れていきました。私も同じ場所に立つとマイクロバスの運転手が声をかけてくれました。“どこへ行く?”私がホテルの名前を告げると彼は“OK10ドル”だと言ってくれました。2~3時間空港で苦勞した私は海の中で突然浮木を見つけたように“OK”と言ってバスに乗り込んでホテルに行きました。それはシャトルバスでした。その時はじめてアメリカにはシャトルバスという便利な乗り物があるのが分かりました。それは各地への見学および2回目のアメリカの学会の時に十分に利用させて頂きました。

私は“Effects of Plasma Parameter on Diamond Deposition at Lower Pressure Using Magneto-Microwave Plasma CVD”のタイトルで発表しました。我々は有磁場マイクロ波プラズマCVDを用いて低圧(0.1~0.01Torr)でダイヤモンド合成を成功しました。それによって、はじめてダイヤモンドのできる領域でのプラズマ診断ができたことでダイヤモンド合成のメカニズムの解明には非常に有利であるとの内容でした。それはほかの研究者から注目され評価されました。質問された時や、論文の別刷を請求された時は、自分の研究はほかの研究者に認めてもらったと感じ、うれしかったのです。そして、会議の休憩の時にもみんなとのdiscussionによって、論文にのっていないいろいろな

成功例と失敗例も聞けて大層有意義でした。自分の研究視野も広がり、世界中の研究者の研究状況を知る絶好の機会でした。

しかし、一つ気がかりになったことは発表者の中に日本から行った若い人は少ないということです。国内学会だと(例えば応用物理学会など)企業の若手研究者、大学院生たちが大変活発に発表しています。しかし、国際学会となると登壇して講演する方は経験豊富の年輩の研究者が多く、若い研究者、特に大学院生は少ないです。そのダイヤモンドのセッションでは、日本から行った大学院生は3人しかいなかったのです。(ちなみに“17th International Conference on Metallurgical Coatings and 8th International Conference on Thin Films”のダイヤモンドのセッションでは私だけでした。)それはちょっとさびしいような感じがしました。というのも、国際化社会になりつつある日本は日本の将来、いいえ、人類の将来を担う若い研究者を国際社会にふさわしい人間に育てるべきだと思います。大学では若い大学院生が研究に欠かせない戦力になっています。学生時代は種々な原因で海外の国際学会に出席するのは難しいかもしれませんが、国際学会で自分の研究を発表し、みんなに認めてもらい、みんなから良いものを吸収するのは、これからの人生に大変有利だと思います。そして、それは研究の原動力にもなります。若い大学院生が積極的に国際学会に出席するべきだと思います。

まとまりのない文章と身勝手な意見を一読下さった皆様に御礼を申し上げます。

最後に国際学会と本稿の執筆の機会を与えて下さった大阪大学工学部電気工学科平木昭夫教授と日頃丁寧にご指導下さっている川原田洋先生に深く御礼を申し上げます。